

名古屋工業大学 受託試験料金 マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)の共用設備

(2026年4月)

受託試験料金は、(装置使用料×装置使用时间+技術料×技術時間+指導料×指導時間)×割引・割増率+オプション料で計算されます。
 装置使用時間は装置を使用している時間、技術時間は試料調製・測定(放置測定を除く)・作業レベルの簡単な解析・データ整理・報告書作成等に対する時間です。
 指導時間は材料学的な知見等を要する解析や試験結果をもとにした改善案の提案等の指導の時間です。
 一般指導料は同分野の専門家であれば一般的なレベルのもの、高度指導料は担当教員が特に知見を有しており他の専門家では指導が難しいレベルのものです。
 (アカデミア割)論文や学会等での発表を目的とした大学・国立研究開発法人等の利用(大学・国立研究開発法人等が支払者となるもの)で、
 発表の際、謝辞等に担当者名や本学名を記載頂ける場合、0.5倍の料金となります。
 (データ提供の非承諾)測定データおよび試料データの二次利用について許諾頂けない場合、2倍の料金となります。
 (報告書提出の非承諾)成果の報告書を提出頂けない場合、1.25倍の料金となります。報告書は文部科学省のHPで公開される予定です。
 オプション料は特別に測定で必要となる消耗品の実費です。
 料金はすべて消費税を含んだ金額です。
 ご依頼方法は <https://kiki.web.nitech.ac.jp/gakugai/> から御覧ください。
 ARIMを利用した研究成果の論文等を執筆する場合、謝辞に課題番号の記載をお願いいたします。

【お見積例①】

原子分解能TEM観察の依頼、測定データのお返しのみ、
 謝辞記載への同意あり、データ提供あり、報告書提出ありの場合
 使用装置:原子分解能分析電子顕微鏡群
 装置使用料:13,200円×7時間×アカデミア0.5
 技術料:5,720円×8時間×アカデミア0.5
 一般指導料:19,800円×0時間
 高度指導料:26,400円×0時間
 オプション料:0円
 合計:75,680円(税込)

【お見積例②】

メスハウアー分光の依頼、高度なデータ解析あり、
 成果は全て非公開の場合
 使用装置:メスハウアー分光装置
 装置使用料及び技術料:37,400円×1スペクトル×データ提供なし2×報告書提出なし1.25
 一般指導料:19,800円×0時間×データ提供なし2×報告書提出なし1.25
 高度指導料:26,400円×1時間×データ提供なし2×報告書提出なし1.25
 オプション料:0円
 合計:159,500円(税込)

(設備ID) 装置名	メーカー・型番	性能・機能	受託試験料金(税込)
(NI-001) 原子分解能分析電子顕微鏡群	日本電子社製 JEM-ARM200F 外	冷陰極電界放出形電子銃、加速電圧:80~200kV 搭載分析装置:エネルギー分散形X線分析装置(EDS)、電子線エネルギー損失分光器(EELS)、デジタルCCDカメラシステム	装置使用料:13,200円/時間 技術料:5,720円/時間 一般指導料:19,800円/時間 高度指導料:26,400円/時間
(NI-003) 白色共焦点顕微鏡	レーザーテック OPTELICS HYBRID C3	白色光源および6波長選択機能 高さ測定、線幅測定、表面粗さ測定(JIS、ISO対応)、3D表示	装置使用料:2,200円/時間 技術料:5,720円/時間 一般指導料:19,800円/時間 高度指導料:26,400円/時間
(NI-004) メスハウアー分光装置群	WissEl 社、ラボラトリ・イクイップメント社、Montana Instruments 社、日本カンタムデザイン社、他(複合システム)	測定可能原子核: ⁵⁷ Fe 核, ¹¹⁹ Sn 核 透過法、内部転換電子検出法 低温測定(5~300 K)	装置使用料及び技術料: 37,400円/スペクトル 一般指導料:19,800円/時間 高度指導料:26,400円/時間 極低温測定:8,580円/L
(NI-005) X線光電子分光装置	アルバック・ファイ PHI Quantes	デュアルソースX線源:Al K α 、Cr K α 機能:ガスクラスターイオンビーム、中和銃、アルゴンスパッタ、 試料加熱室、トランスファーベッセル	装置使用料:11,000円/時間 技術料:5,720円/時間 一般指導料:19,800円/時間 高度指導料:26,400円/時間
(NI-006) UV/VIS/NIR分光光度計	日本分光製 V570	波長範囲190nm~2500nm、測光範囲-2~3Abs 付属品:絶対反射率測定装置 ARN475 1回反射測定装置 SLM468 積分球装置 ISN470 フィルムホルダ FLH466 その他:透過測定には液体N ₂ 、液体Heクライオスタットを使用可能	装置使用料:2,200円/時間 技術料:5,720円/時間 一般指導料:19,800円/時間 高度指導料:26,400円/時間
(NI-008) 単結晶X線構造解析装置群	(株)リガク社製 VariMax with DW RAPID	Cu線源とMo線源に対応、出力:1.2 kW、湾曲型人工多層膜集光ミラー装備 測定温度:-180°C~室温	装置使用料:5,280円/時間 技術料:5,720円/時間 一般指導料:19,800円/時間 高度指導料:26,400円/時間
(NI-010) 表面増強赤外分光装置	日本分光 FT-IR4200ST	測定範囲:4,000~1,000 cm ⁻¹ in situ測定(電気化学)	装置使用料:1,760円/時間 技術料:5,720円/時間 一般指導料:19,800円/時間 高度指導料:26,400円/時間
(NI-011) 飛行時間型二次イオン質量分析装置	アルバック・ファイ PHI TRITFV nano TOF	質量分解能(無機材料):9,000M/ $\Delta\mu$ 以上 質量分解能(有機材料):9,000M/ $\Delta\mu$ 以上(PET(m/z 104)にて)	装置使用料:10,560円/時間 技術料:5,720円/時間 一般指導料:19,800円/時間 高度指導料:26,400円/時間
(NI-012) 顕微蛍光X線分析装置	堀場製作所 XGT-7200VNM	エネルギー分散型蛍光X線分析 測定対象元素:Na~U	装置使用料:2,200円/時間 技術料:5,720円/時間 一般指導料:19,800円/時間 高度指導料:26,400円/時間
(NI-013) 高精度ガス/蒸気吸着量測定装置	日本ベル株式会社製 BELSORP-max	細孔分布:直径0.35~500nm、 最小比表面積:0.01m ² /g(N ₂)	装置使用料:1,760円/時間 技術料:5,720円/時間 一般指導料:19,800円/時間 高度指導料:26,400円/時間

(設備ID) 装置名	メーカー・型番	性能・機能	受託試験料金(税込)
(NI-014) 高周波透磁率測定装置	凌和電子(株)社製 PMF-3000	1MHz~3GHzの広帯域透磁率測定 試料サイズ5~6(W)×5(L)×1mm(t)	装置使用料:2,200円/時間 技術料:5,720円/時間 一般指導料:19,800円/時間 高度指導料:26,400円/時間
(NI-015) 振動試料型磁束計	東英工業(株)社製 VSM-5	最大印加磁場 1.5T	装置使用料:2,640円/時間 技術料:5,720円/時間 一般指導料:19,800円/時間 高度指導料:26,400円/時間
(NI-017) 精密形状測定・局所磁気測定・局所電気特性評価装置	日本電子社製 JSPM-5200TM	特型、分解能:原子分解能、CNF探針装備 測定モード:形状、電気特性、磁気特性測定	装置使用料:2,640円/時間 技術料:5,720円/時間 一般指導料:19,800円/時間 高度指導料:26,400円/時間
(NI-018) 磁気特性測定装置	日本カンタムデザイン(株)社製 MPMS3	最大印可磁場 7 T 感度(VSM) 1×10^{-8} emu 交流磁化測定	装置使用料:1,760円/時間 技術料:5,720円/時間 一般指導料:19,800円/時間 高度指導料:26,400円/時間
(NI-019) 走査電子顕微鏡装置	日立ハイテック S-4700	冷陰極電界放出形電子銃、加速電圧:~20kV 搭載分析装置:エネルギー分散形X線分析装置(EDS)	装置使用料:2,640円/時間 技術料:5,720円/時間 一般指導料:19,800円/時間 高度指導料:26,400円/時間
(NI-020) ICP発光分光分析装置	島津サイエンス ICPE-9820	マルチチャンネル型、波長範囲167~800 nm フッ酸試料導入オプション	装置使用料:2,640円/時間 技術料:5,720円/時間 一般指導料:19,800円/時間 高度指導料:26,400円/時間
(NI-021) 複合ビーム加工観察装置	日本電子 / JIB-4700F	3D-SEM、TEM試料作製	装置使用料:7,040円/時間 技術料:5,720円/時間 一般指導料:19,800円/時間 高度指導料:26,400円/時間
(NI-101) プラズマ・ガス凝縮クラスター堆積装置	日本ビーテック 特別仕様	クラスターサイズ 直径3~15nm 直流マグネトロンスパッタリング方式	装置使用料:4,400円/時間 技術料:5,720円/時間 一般指導料:19,800円/時間 高度指導料:26,400円/時間
(NI-102) スパッタリング蒸着装置	アルバック社製 SPC-2000HC	13.56MHz 200W	装置使用料:2,200円/時間 技術料:5,720円/時間 一般指導料:19,800円/時間 高度指導料:26,400円/時間
(NI-103) 真空蒸着装置	シンク社製 SK-80K	マイカ基板サイズ:15×15mm(標準)、 マイカ厚み:0.1~0.15mm、 金膜厚:100~150nm	装置使用料:1,760円/時間 技術料:5,720円/時間 一般指導料:19,800円/時間 高度指導料:26,400円/時間
(NI-104) 中規模カーボンナノファイバー室温合成装置	自作	カーボンナノファイバー室温合成速度:10 nm/min以上 試料サイズ:1インチ程度以下	装置使用料:3,080円/時間 技術料:5,720円/時間 一般指導料:19,800円/時間 高度指導料:26,400円/時間
(NI-105) 特型表面ナノ構造形成装置	ULVAC社製 特型	標準2インチ基板、超斜め入射イオンビームによるマスクレスの表面ナノ構造・ナノドット形成可能、組成制御可能、高分子材料の加工可能	装置使用料:2,200円/時間 技術料:5,720円/時間 一般指導料:19,800円/時間 高度指導料:26,400円/時間
(NI-106) グラフェン・カーボンナノチューブ合成装置	自作特型	CVDによるグラフェン、単層CNTの合成	装置使用料:2,640円/時間 技術料:5,720円/時間 一般指導料:19,800円/時間 高度指導料:26,400円/時間